



マルバーン・パナリティカル製品
予算申請用カタログ



マルバーン・パナリティカル製品一覧表

マルバーン・パナリティカルは、粒子計測や X 線分析など、多彩な測定機器を揃えています。

	500 万円以下	501 万円 ～ 1,000 万円	1,001 万円以上
粒子計測		粒子径・ゼータ電位・分子量測定装置 P.4 レーザー回折式粒子径分布測定装置 P.3	粒子径・ゼータ電位・分子量測定装置 P.4 粒子画像およびラマン分光分析装置 P.3 ナノトラッキング粒子径測定装置 P.5 スプレー専用レーザー回折式粒子径分布測定装置 P.3 オンライン・インライン レーザー回折式粒子径分布測定機 P.6 インライン粒子測定プローブ P.6
粒子計測・流動性分析			粉体流動性分析装置 P.5
分子間相互作用解析装置			ラベルフリー分子間相互作用解析装置 P.7
マイクロカロリーメーター			等温滴定型カロリーメーター P.8 示差走査型カロリーメーター P.8
元素分析	エネルギー分散型蛍光X線分析装置（卓上・PC一体型） P.9	エネルギー分散型蛍光X線分析装置（卓上型）試料前処理装置 P.9 P.11	波長分散型蛍光X線分析装置 P.10 次世代 卓上型蛍光X線分析装置 P.10
構造解析		卓上型X線回折装置 P.12	多目的X線回折装置 P.13 薄膜X線回折装置 P.13
結晶方位			卓上型X線結晶方位測定装置 P.14 高精度・高速X線結晶方位測定装置 P.14 ウエハー用高精度・高速X線結晶方位測定装置 P.14

粒子径分布測定装置の測定原理と測定範囲

掲載ページ	機器名 測定原理	測定範囲 0.1nm 1nm 10 nm 100 nm 1μm 10μm 100μm 1mm
P.3	レーザー回折式粒子径分布測定装置 マスターサイザー 3000+ レーザー回折・散乱法	0.01 ～ 3,500 μm
P.3	スプレー専用レーザー回折式粒子径分布測定装置 スプレーテック レーザー回折・散乱法	0.1 ～ 2,000 μm
P.3	粒子画像分析装置 モフォログ 4 シリーズ 静的画像解析法	0.5 μm ～ 13 mm ※貼り合わせ機能使用時
P.4	粒子径・ゼータ電位・分子量測定装置 ゼータサイザーアドバンスシリーズ ゼータ電位：電気泳動光散乱法 粒子径：動的光散乱法 分子量：静的光散乱法	0.3 nm ～ 10 μm
P.5	ナノトラッキング粒子径測定装置 ナノサイト Pro ナノトラッキング法	10 nm ～ 1 μm

掲載ページ	機器名 測定原理	測定範囲 0.1nm 1nm 10 nm 100 nm 1μm 10μm 100μm 1mm
P.6	オンライン・インラインレーザー回折式粒子径分布測定機 インシテック レーザー回折・散乱法	0.1 ～ 2,500 μm
P.6	インライン粒子測定プローブ Parsum 空間フィルタ速度計測法	50 ～ 6,000 μm

粒子計測

レーザー回折式粒子径分布測定装置

マスターサイザー 3000+ 湿式／乾式

希望販売価格（税抜）553 万円～

世界累計 1 万台以上、分析装置評価サイトで最高レベル評価を取得。測定範囲は 0.01 ～ 3,500 μm という幅広い測定範囲。測定をサポートする、データクオリティー・ガイダンスや安定したデータと不安定なデータを分離するアダプティブ・ディフракション、最適な測定条件を提案する SOP アーキテクト機能搭載。

特 長

- 装置本体は、W690 mm × D300 mm × H450 mm とコンパクト
- 様々なサンプルに対応可能な、5 種類の湿式分散ユニット
- 乾式分散ユニットは空気力学に基づき壊れやすい粒子から凝集粒子まで最適な分散を実現
- 1 秒間に 10,000 回の高速データ取得により、良好な再現性と精度の高さを両立
- オプションとして、フロー式粒子画像撮像ユニットや 7 mL 微量セル・高濃度ペーストセルもご用意



測定範囲

0.01 ～ 3,500 μm

スプレー専用レーザー回折式粒子径分布測定装置

スプレーテック スプレー

希望販売価格（税抜）1,330 万円～

気中に散布された粒子を瞬時に正確に測定します。噴霧状態を瞬間ごとにディスプレイし、高精度でリアルタイムな測定を実現しました。

特 長

- 最大 10 kHz の高速測定で噴霧中の粒子径の急激な経時変化をキャッチ
- 多重散乱補正機能により高精度な噴霧粒子でも正確に測定
- 鼻孔スプレー・カスケードインパクト・湿式セル等豊富なオプション



測定範囲

0.1 ～ 2,000 μm

粒子画像およびラマン分光分析装置

モフォロギ 4 シリーズ 湿式／乾式

希望販売価格（税抜）1,470 万円～（PC 込み）

ラマン分光分析装置付モフォロギ 4-ID については別途お問い合わせください。

医薬品やセラミックス、電池や化学品などに適応可能な分析装置です。全自動で粒子径と粒子形状を測定。また、ラマン分光機能を加えたモフォロギ 4-ID は、粒子径と粒子形状情報の機能に加え、化学情報（ラマンスペクトル）を取得します。

特 長

- 本体一体式の粉体分散ユニットが再現性の高い自動分散を実現
- ウェットセル、フィルターオプションなど豊富なサンプリングアクセサリに対応
- 全自動化可能。研究から QA/QC まで幅広く対応



測定範囲

0.5 μm ～ 1,300 μm

ラマン分光法 1 μm ～ 1,300 μm （化学分析）

粒子計測

粒子径・ゼータ電位・分子量測定装置

ゼータサイザーアドバンスシリーズ

希望販売価格（税抜）786 万円～（Lab）

987 万円～（Pro）

1,290 万円～（Ultra）

アクセサリ: サンプル・アシスタント

1,000 万円

3機種×2系統の計6機種に生まれ変わったゼータサイザーアドバンスシリーズ。さまざまなラインナップで、ナノテクノロジー、バイオテクノロジーの研究・開発・品質管理に貢献します。

アクセサリのサンプル・アシスタントは、キューベットベースの協働ロボットオートサンプラーです。キューベットベースのため、洗浄工程なし、コンタミなし、装置へのセルの抜き差しをロボットアームが自動で実施。

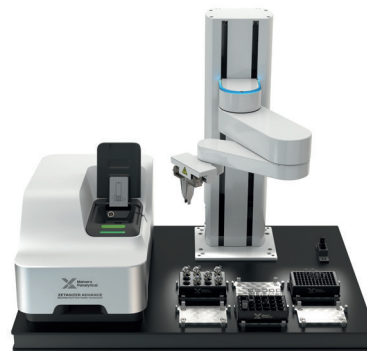
特 長

- 新型アルゴリズムを搭載し、粗大粒子の影響を最小に抑えての粒子径測定が可能
- 多角度動的光散乱（MADLS）を使用し、粒子径分布の精度、分解能力が向上※¹、粒子濃度情報も表示※²
- 高濃度サンプルに対応
- 各種サンプルセル、自動滴定装置（MPT-3）などの豊富なオプションをご用意
- バンドパスフィルタを標準搭載、ソフト上で ON / OFF の切替が可能※³

※¹ MADLS は Ultra-Blue、Red で使用可能

※² 粒子濃度解析は、Ultra-Red のみ

※³ Pro-Blue、Red、Ultra-Blue、Red のみ



粒子径測定範囲

0.3 nm ～ 10 μm

ゼータ電位測定範囲

3.8 nm ～ 100 μm

サンプル・アシスタント測定項目

粒子径、MADLS、ゼータ電位

粒子計測

ナノトラッキング粒子径測定装置

ナノサイト Pro

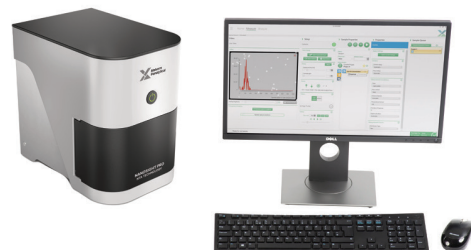
希望販売価格（税抜）1,543 万円～

*PC別途、紫レーザーの場合

粒子のブラウン運動を追跡し、粒子ごとに測定するため、高い分解能での粒子径分布や粒子個数濃度が得られます。

特 長

- 粒子のブラウン運動を画像追跡する新方式
- 個数基準による粒子径分布表示
- 粒子濃度の算出
- 粒子の屈折率パラメータが不要



測定範囲

10 nm ～ 1 μm

粉体流動性分析

粉体流動性分析装置

パウダーレオメーター FT4

希望販売価格（税抜）1,230 万円～

測定前の粉体サンプルを、そのままの状態ですべて測定します。せん断応力や壁面摩擦など測定項目が豊富で、粉体の流動性評価を再現性よく数値化。

特 長

- 10 mL のサンプルから測定可能
- 測定前のコンディショニングサイクルによる再現性の良い測定
- 多彩な流動性測定を 1 台で実現



試験項目

安定性試験、流速変化試験、圧縮試験、
通気試験、透過性試験、圧縮性試験、
せん断試験、壁面摩擦試験

粒子計測

オンライン・インライン レーザー回折式粒子径分布測定機 インシテック

販売価格をご照会下さい。

粉体製造プロセスの現場では、製品の粒子径分布測定は必須です。インシテックは乾式、湿式プロセスいずれにも対応可能な全自動粒子径分布測定機です。刻々と表示されるプロセス配管内のリアルタイムな粒子径分布データを利用し、上流の製造機器をフィードバック制御することも可能です。

特 長

- 製造プロセスへの取り付けが可能な堅牢な設計
- 24 時間連続モニタリング



仕 様

測定原理：レーザー回折法（Mie理論とFraunhofer 近似および多重散乱補正機能〔特許〕）
測定範囲：0.1 ～ 2,500 μm
光源：半導体レーザー（波長 $\lambda = 670 \text{ nm}$ 1 mW）
オプション：本質安全防爆仕様 ATEX (Ex ia IIC T4)

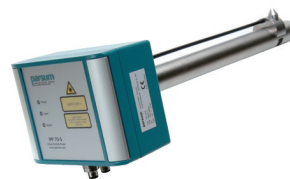
インライン粒子測定プローブ Parsum

販売価格をご照会下さい。

堅牢で使いやすいインラインのプローブ型粒子径測定機です。

特 長

- コンパクトな光学系
- 粒子の高速通過に対応
- 毎秒 10,000 粒子まで測定
- 防爆対応



仕 様

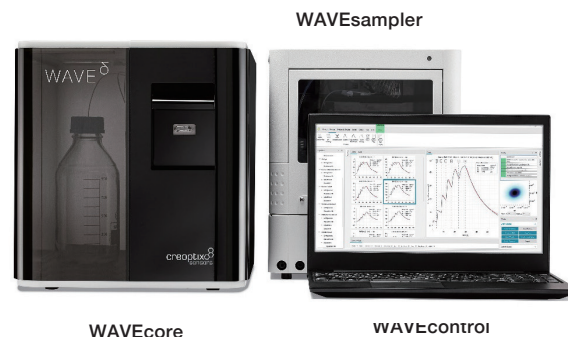
測定原理：空間フィルタ速度計測法
測定範囲：50 ～ 6,000 μm
測定ポイント動作温度：-20 $^{\circ}\text{C}$ ～ 100 $^{\circ}\text{C}$

分子間相互作用解析装置

ラベルフリー分子間相互作用解析装置
(グレーティング結合干渉法：GCI)

Creoptix® WAVEsystem
クレオプティックス ウェーブシステム

希望販売価格（税抜）2,360 万円～



ラベルフリーサンプルのリアルタイムカインेटィクス測定を行う、低容量のサンプルとハイスループットを達成する、分子間相互作用解析装置です。

特 長

- $R_{\max} < 1 \text{ pg/mm}^2$ の高感度
- 速い解離を見逃さない ($K_d = 10^{-5} \sim 10^{-1} \text{ s}^{-1}$)
- 流路一体型のセンサーチップは詰まりやすいクールドサンプルの取り扱いも安心
- サンプル希釈が不要の waveRAPID で、サンプル数と Buffer を削減
- 従来のカインेटィクス測定の約 10 倍*のスピード
- 使いやすいセットアップとデータ解析でアカデミアにも最適

*waveRAPID 使用時 当社調べ

モデル	WAVEdelta 4チャンネル 低温・高速対応モデル	WAVE 2チャンネル エントリーモデル
Flow Channels	4	2
結合速度定数 (k_a)レンジ	$10^3 - 5 \times 10^7 \text{ M}^{-1} \text{ s}^{-1}$ (低分子) $10^3 - 3 \times 10^9 \text{ M}^{-1} \text{ s}^{-1}$ (高分子)	
解離速度定数 (k_d)レンジ	$10^{-5} - 10 \text{ s}^{-1}$	
流速	1 - 400 $\mu\text{L/min}$	
セットできるBuffer数	4	1
測定温度範囲	4 - 45 $^{\circ}\text{C}$	15 - 40 $^{\circ}\text{C}$
waveRAPID	○	×

マイクロカロリメーター

等温滴定型カロリメーター

MicroCal PEAQ-ITC

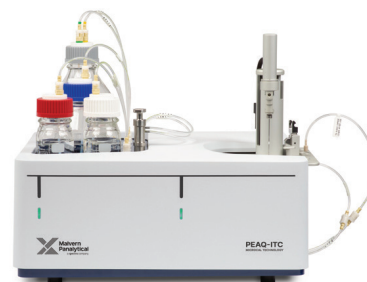
希望販売価格（税抜）2,590 万円～

アカデミア価格※¹（税抜）1,920 万円～

溶液中の分子が相互作用したときに生じる微小な熱量変化を測定し、結合の強さ、メカニズムを解析します。

特 長

- 溶液中の分子間相互作用をダイレクトに測定
- サンプルのラベル化および固定化が不要
- 分子量の制限なし
- サンプルの充填、セル洗浄など全機能を完全自動制御※²



取得可能パラメータ

K_D 、結合比、 ΔH 、 ΔS 、 ΔG

測定温度範囲

2 ~ 80 °C

セル容量

200 μ L

示差走査型カロリメーター

MicroCal PEAQ-DSC

希望販売価格（税抜）2,240 万円～

アカデミア価格※¹（税抜）1,420 万円～

溶液中の分子の構造が熱変性したときに生じる微小な熱量変化を測定し、熱安定性を評価します。

特 長

- 標識試薬不要
- 溶液中のサンプルの安定性や同等性を評価
- サンプルの充填、セルの洗浄など全機能を完全自動制御※³
- 同等性評価機能と解析 SOP（標準作業基準）の作成が可能
- FDA 21 CFR Part 11 に対応（オプション）



取得可能パラメータ

T_m 、 ΔH 、 ΔC_p 、 T_{onset}

測定温度範囲

2 ~ 130 °C

セル容量

130 μ L

※¹ アカデミア価格は、大学及び公的研究機関向けです

※² 完全自動制御対応機種は PEAQ-ITC Automated となります

※³ 完全自動制御対応機種は PEAQ-DSC Automated となります

元素分析

卓上・PC 一体型 EDX

Epsilon1

イブシロン 1

希望販売価格（税抜）400 万円～（設置調整費込）

アカデミア価格※¹ 販売価格をご照会下さい。



特 長

- 重量 24 kg。軽量の制御用 PC 一体型 XRF システム（PC 拡張可能）
- 真空系不要。大気中測定であらゆるサンプル形態に対応
- 高い ROI と最小限のコストで元素分析（分析コスト100円以下／測定）
- ユーティリティは 100 V 電源以外不要
- CCD カメラを内蔵した 1 mm φサイズのスポットサンプル観察に対応の微小部測定モデルもご用意

測定範囲

11 Na ～ 95 Am

装置構成

管球セラミックス絶縁 X 線管球：Ag アノード

X 線管球出力：10 W

検出器：LN 不要・高分解能 SDD

最大計数率：1,500 kcps

真空系：不要

自動モニター校正機能：付属

大型試料ステージ：付属

ソフトウェア：日本語

設置条件

電源：100 ～ 240 V

液体窒素不要モデル

サイズ：H384 × W395 × D375 (mm)

重量：24 kg

設置可能環境：5 ～ 35℃（結露無き事）

磁場変動：＜30 A/m

粉塵レベル：一般的なレベル以下、IP40

※¹ アカデミア価格は、大学及び公的研究機関向けです。

卓上型・EDX

Epsilon4

イブシロン 4

希望販売価格（税抜）800 万円～



特 長

- 真空系不要、大気測定であらゆるサンプル形態に対応
- 業界初、スイッチング発生器を採用。KV-mA を測定元素の最適条件に設定することで S/N 比を改善し、ppm レベル分析が可能に
- 最大 1,500 kcps というリニアリティを持つ計数回路を搭載。より正確な校正へ

測定範囲

6 C ～ 95 Am / 9 F ～ 95 Am

装置構成

X 線管球アノード：Ag、Rh、Mo

X 線管球出力：15 W / 10 W

検出器：LN 不要・高分解能 SDD

最大計数率：1,500 kcps

真空系：不要

自動モニター構成機能：付属

大型試料ステージ：付属

10 試料自動交換機：内蔵

スピナー機能：付属

ソフトウェア：日本語他

設置条件

電源：90 ～ 264 V 47 ～ 63 Hz

消費電力：250 VA

液体窒素不要

サイズ：H270 × W530 × D510 (mm)

重量：47 kg

設置可能環境：5 ～ 35℃（結露無き事）

磁場変動：＜30 A/m

粉塵レベル：一般的なレベル以下、IP40

He ガス：任意置換時（PC 制御）

元素分析

波長分散型蛍光 X 線分析装置

Zetium

ゼティウム

希望販売価格（税抜） **1,700 万円**～



特 長

- WDX のプラットフォームにEDX機能が搭載可能。高速・高精度分析、局所分析、マッピング分析に対応可能なハイブリット XRF
- 業界初のドリフトフリー管球により、標準化校正・ドリフト補正の工数が最小限に
- 特許技術によるX線管球の長寿命化により、ランニングコストの大幅削減が可能
- チラー不要の 1 kWタイプからハイエンドの 4 kWタイプまでの幅広いラインナップで、パルク・液体・粉体・薄膜等、様々なニーズに対応

測定範囲

4 Be ～ 95 Am

装置構成

X 線管球アノード：Ag、Cr 及び Rh

X 線管球出力：1、2.4、3、4 kW

マッピング機能：選択可能（オプション）

ゴニオメータ：DOPS 制御（2,400° / 分）

局所分析：500 μm ～（オプション）

EDX 機能：選択可能（オプション）

波高分布校正：PHD 自動機能付属

ソフトウェア：日本語

設置条件

電源：200 ～ 240 V

コンプレッサーエア：＜0.5 MPa

サイズ：H1,510 × W840 × D1,120 (mm)

重量：600 kg（4 kW モデル）

設置可能環境：10 ～ 30℃（結露無き事）

磁場変動：EN61000-6-2 に適合

粉塵レベル：IP20 空冷もしくは水冷冷却水

送水装置（1 kW モデルは不要）

次世代 卓上型蛍光 X 線分析装置

Revontium

レボンティウム

販売価格をご照会下さい。



コンパクトで WDXに迫る性能、高品質元素分析。

特 長

- 大気雰囲気下での測定可能
- WDXRF や AAS、ICPと比較し、所有コスト 25% 削減
- 最大 6000 kcps の高速分析
- 検出器は最大 4 つまで可能
- 固体と液体を同時分析可能
- 管球ドリフトを抑えた特殊管球

試料前処理装置

ガラスビード・アルカリ溶融前処理装置

FORJ

フォージ

希望販売価格（税抜）780 万円～



特 長

- XRF 用ガラスビード作製、ICP アルカリ溶融、AA 用乾式分解の前処理が一台で可能
- 用途に応じた溶解プログラムをプリセット
- 試料装填数は標準 6 試料
- トレイローダー※オプションで最大 12 試料まで拡張可能
- 降温速度が従来機の約 10 倍の速度（1150℃→550℃まで約 10 分）
- 専用排気ダクトアダプター（オプション）

装置構成

加熱方式：電気抵抗炉
 加熱範囲：RT ～ 1,200℃
 自社製フラックス：LIT/LIM、混合タイプも準備
 冷却水：不要
 作成レシピの提供：可能
 制御：タッチスクリーンオペレーション
 外部ポート：USB ポート付属

設置条件

電源：単相 200 ～ 240 V 50/60 Hz
 最大負荷電流：30 A
 サイズ：H710 × W1,020 × D720 (mm)
 重量：127 kg
 設置可能温度：15 ～ 35℃
 設置環境湿度：50 ～ 80 %

ガラスビード・アルカリ溶融前処理装置

LeNeo

レネオ

希望販売価格（税抜）420 万円～



特 長

- XRF 用ガラスビード作成、ICP 用アルカリ溶融、AA 用乾式分解の前処理が一台で可能
- フッ化水素酸などの危険な酸が不要で、残渣の無い完全分解を実現
- 前処理の所要時間は 1 試料あたり約 15 分
- 高純度（99.98%）・超高純度（99.995+%）のフラックスを用意。ガラス化で吸湿性の心配も無く、あらかじめ剥離剤を混合した提供も可能

装置構成

加熱方式：電気抵抗炉
 加熱範囲：RT ～ 1,200℃
 自社製フラックス：LIT/LIM、混合タイプも準備
 冷却水：不要
 作成レシピの提供：可能
 制御：タッチスクリーンオペレーション
 外部ポート：USB ポート付属

設置条件

電源：200 ～ 240 V 50/60 Hz 対応
 最大負荷電流：20 A
 サイズ：H535 × W550 × D585 (mm)
 重量：33 kg
 設置可能温度：15 ～ 35℃
 設置環境湿度：50 ～ 80 %

構造解析

卓上型 XRD

Aeris

エアリス

希望販売価格（税抜）900 万円～



特 長

- 大型装置と同じ機構を持つゴニオメータ（DOPS）と検出器を搭載
- 据置機と同等の性能を卓上機で実現。高精度リートベルト分析にも対応可能
- 試料水平方式の採用で粉末試料の脱落的心配なし
- 指先も X 線管理区域に入ることのない徹底した安全設計
- 透過測定・薄膜測定にも対応

X線管球

Cu、Co

装置構成

試料水平 θ - θ ゴニオメータ

出力：300 W

オプション

1D → 2D の検出器変更

300 W → 600 W の出力変更

高分解能パッケージ

6 試料チェンジャー

結晶構造解析ソフトウェアオプション

ICDD データベース

設置条件

電源：100 V、200 V、15 A

冷却水循環装置内蔵

サイズ：H690 × W770 × D786 (mm)

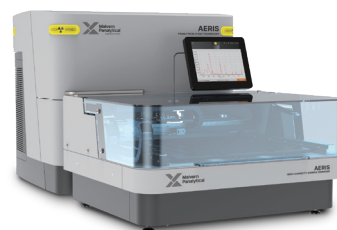
重量：180 kg

Aerisハイキャパシティサンプルチェンジャー

Aeris用の大容量のサンプルチェンジャーです。
60 以上のサンプルをセット可能で、24 時間連続自動分析を実現。
装置稼働率をUPし、最大 50 % のオペレータ作業負担を削減します。

特 長

- 無人運転による 24 時間稼働を実現
- 柔軟なサンプルQueue管理
- リソース管理を効率化
- コスト効率に優れたコンパクト設計



仕 様

サンプル容量：

3枚の取り外し可能なサンプルトレイ（各トレイ 21 サンプルポジション）に加え、4つの固定サンプルポジションを備えたバルコニーがあり、合計で 67 個の 51.5 mm サンプルホルダーを収納可能です。

サンプルロード：外付けサンプルローディング

サンプルの交換：ピックアップヘッドを備えた XYZ 軸ロボット制御機構

設置条件

サイズ：H393 × W770 × D729 (mm)

重量：40 kg

電源：100-240 V、single phase

構造解析

多目的 XRD

Empyrean

エンピリアン

希望販売価格（税抜）1,980万円～



特長

- 多様なサンプル測定に自動光学系が対応
- 簡単操作で XRD を実現
- SAXS（X線小角散乱）、電池透過オペランド測定、薄膜測定、温度可変等の高度な測定にも柔軟に対応
- 金属など蛍光X線が発生しやすい試料のノイズを低減する高エネルギー分解能半導体検出器もご用意

X線管球

Cu、Co、Mo、Ag

装置構成

X線光学系 iCore, dCore（集中法、平行法、微小部、SAXS 光学系自動交換）

検出器：PIXCel 検出器、1Der 検出器

オプション

5 軸（ $\Phi\chi\psi\omega\theta$ ）クレードル

非接触高さ調整センサ、CCD カメラ

高温、低温冷却アタッチメント

各種解析ソフトウェア：粉末、極点、SAXS、残留応力、X線反射率、化合物半導体薄膜解析 (AMASS)

設置条件

電源：本体 200 V 単相、冷却水 200 V 三相

循環装置：室内水冷、空冷又は室外空冷

サイズ：H1,947 × W1,400 × D1,162 (mm)

重量：1,050 kg

薄膜 XRD

X'Pert³ MRD

エキスパート³ MRD

希望販売価格（税抜）2,600 万円～



特長

- 4 インチウエハーの全面XYマップ（MRD）と 8 インチウエハーの全面XYマップ（MRDXL）
- 幅広い測定に対応する Prefix 光学系モジュール
- 薄膜研究の初期段階、面内配向や極点図からエピタキシャル膜の歪み解析などエピタキシャル薄膜の分析に最適のツール
- 超高速な逆格子マッピングにより極薄膜の測定が可能

X線管球

Cu、Co

装置構成

試料垂直 ω -2 θ ゴニオメータ

半導体検出 PIXcel

5 軸（ $\Phi\chi\psi\omega\theta$ ）クレードル

オプション

極点、X線反射率、化合物半導体薄膜解析 (AMASS)

設置条件

電源：本体 200 V 単相、冷却水 200 V 三相

循環装置：室内水冷、空冷又は室外空冷

サイズ：H1,972 × W1,370 × D1,131 (mm)

重量：1,150 kg

構造解析

卓上型 X 線結晶方位測定装置

SDCOM

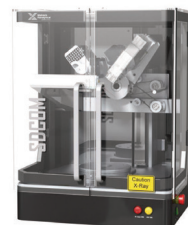
エスディーコム

希望販売価格（税抜）2,000 万円～

コンパクトで、高性能の結晶方位測定が可能。測定時間はわずか 10 秒。

特 長

- 高精度測定 $< 0.01^\circ$
- 上面照射型
- インゴット及びウエハー検査に対応
- 1 mm～サンプル測定可能
- マッピングオプション
- 冷却水不要



電源

100-230 V、単相、500W

装置サイズ

H840 × W600 × D600 (mm)

重量

100kg

単結晶

六方晶と三方晶：SiC 2H、4H、6H、15R、GaN、ZnO、LiNbO₃、SiO₂（石英）、Al₂O₃（サファイア）、GaPO₄、La₃Ga₅SiO₁₄、etc

高精度・高速 X 線結晶方位測定装置

Omega-Theta

オメガシータ

希望販売価格（税抜）4,000 万円～

あらゆる単結晶に対応し、高精度な測定が可能。

特 長

- わずか 10 秒の高速測定
- 高精度測定 $< 0.003^\circ$ / $< 0.03^\circ$ (1σ)
- 試料水平型ゴニオメーター
- 結晶方位・ θ スキャン・XRC
- モノクロメーター等の拡張オプション
- 小片から Φ 590 mm のインゴットまでカバー



電源

208-240 V、16A、単相、50-60Hz

装置サイズ

H1,950 × W1,200 × D820 (mm)

重量

650kg

単結晶

Si、Ge、SiC、AlN、GaN、GaAs、Quartz、LiNbO₃、CdTe、BBO、etc

ウエハー用高精度・高速 X 線結晶方位測定装置

Wafer-XRD

希望販売価格（税抜）5,000 万円～

ウエハーの製造・品質管理に対応した完全自動X線回折システムです。結晶方位に加え、ノッチやフラットのような幾何学的特徴、距離測定、抵抗率などを測定できます。

特 長

- 超高速・高精度を実現する方位角スキャン方式
- 25 枚のウエハーをわずか 10 分で測定
- スループット：10,000 / 月以上のウエハー
- ウエハー形状：ご要望に応じて対応可能



電源

400 V、16A、3相4線、500W

装置サイズ

H1,740 × W1,261 × D1820 (mm)

重量

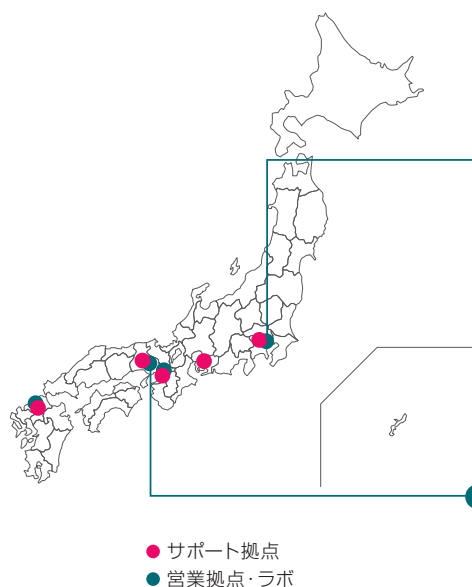
650kg

単結晶

Si、SiC、GaAs、GaN、Sapphire (Al₂O₃)、Ge、AlN、Quartz、InP and 100s more

業界最高レベルのサポートサービスを日本のお客様に

国内5拠点、30名以上の充実した体制と充実したDigital Solutionにより全国を24時間365日サポート*



東京浜松町オフィス

オフィス／アプリケーションラボ

主な設備：粒度計測装置（LD／DLS／画像／NTA）、分子間相互作用解析装置、マイクロカロリーメーター、X線元素分析装置（EDX・WDX）、X線構造解析装置（XRD）、X線結晶方位測定装置、試料前処理装置（ガラスビードアルカリ溶融前処理装置）



神戸オフィス

オフィス／アプリケーションラボ

主な設備：粒度計測装置（LD／DLS／画像／NTA／オンライン・インライン）、粉体流動性分析装置、X線元素分析装置（EDX）、X線構造解析装置（XRD）

弊社では国内においても最高レベルのノウハウと、リソースを持ったカスタマーサービススタッフを国内5拠点に30名以上配置し、手厚いサポート体制で万全の対応を実現しています。

技術サポートだけでなく、導入時・導入後のアプリケーション及び教育サポートも提供していますので、運用面でも安心してご導入、活用いただけます。

充実したDigital Solutionを提供。電話・メール・ポータルサイトを通じた多様なお問い合わせチャンネルに加え、ネットワークで常時監視するSmart managerによる装置の直接診断も可能です。

*一部製品、有償

個別相談会

マルバーン・パナリティカルでは、装置ユーザ様や購入を検討されている方を対象に、東京と神戸のラボで個別相談会を実施しています。
お気軽にお問合せください。





お問い合わせ先

スペクトリス株式会社

マルバーン・パナリティカル事業部

東京事業所

ラボ併設

〒105-0013 東京都港区浜松町1-7-3 第一ビル
TEL:03-5733-9511 FAX:03-6735-8974

神戸事業所

ラボ併設

〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町5-5-2
神戸国際ビジネスセンター北館511
TEL:078-306-3806 FAX:078-306-3807

大阪営業所

〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-5-24
新大阪第一生命ビル11F
TEL:06-6396-8501 FAX:06-6396-8505

福岡博多営業所

〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-11-27
TEL:092-473-3787 FAX:092-510-0536

福岡古賀営業所

〒811-3102 福岡県古賀市駅東2-8-12-203
TEL:092-943-1410 FAX:092-943-1420

取扱店

外観および仕様は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

Disclaimer: Although diligent care has been used to ensure that the information in this material is accurate, nothing herein can be constructed to imply any representation or warranty as to the accuracy, correctness or completeness of this information and we shall not be liable for errors contained herein or for damages in connection with the use of this material. Malvern Panalytical reserves the right to change the content in this material at any time without notice.
Copyright: © 2025 Malvern Panalytical. This publication or any portion thereof may not be copied or transmitted without our express written permission.